

本記事は,文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ」技術スタッフ表彰について紹介するものです.



文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ 令和 4 年度技術スタッフ表彰 優秀技術賞 **TEM データを味わい尽くす** ~画像処理・機械学習・統計解析で電子顕微鏡データから有効な情報を引き出す~

受賞者 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 上杉 文彦氏に聞く

文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM Japan)」 [1] は、2021 年度(令和3年度)からスタートし、前代プロジェ クト「ナノテクノロジープラットフォーム(NPJ)」の最先端装 置の共用、高度専門技術者による技術支援に加え、新たにリモー ト・自動化・ハイスループット対応型の先端設備を導入し、広がり・ 高度化する応用専門領域の利用者に対応する材料開発のための高 度な先端装置の共用や技術支援の提供を行いつつ、装置利用に伴 い創出されるマテリアルデータを、利活用しやすいよう構造化し た上で提供し、データ駆動型研究開発に貢献することを目的とす る.また、文部科学省の革新的機能を有する材料開発を実施する 「データ活用型マテリアル研究開発プロジェクト」[2] とも連携し て、我が国のマテリアル革新力強化に資することを狙う.

ARIM Japan の基礎となる,全国的な最先端共用設備体制と高 度専門技術者による技術支援は、2012 年度(平成10年度)か ら10年にわたり実施してきた NPJ から引き継いだ.最先端共用 設備の有効活用には、高度な専門技術を有する技術スタッフの支 援が不可欠である.技術スタッフの貢献に報い、その育成を図ろ うと、NPJ は 2014 年度より技術スタッフ表彰を始めた.表彰に は、優秀技術賞(類い稀な秀でた技術),技術支援貢献賞(技術 支援で貢献),若手技術奨励賞(35歳以下の技術スタッフが対象) の3つの賞がある.技術スタッフ表彰も ARIM Japan に引き継が れて令和4年度は、優秀技術賞1件,技術支援貢献賞4件が選 ばれた[3].表彰式は2023年2月1日に第22回国際ナノテク ノロジー総合展・技術会議(nano tech 2023,東京ビッグサイト で開催)の中で行われた.

令和4年度技術スタッフ表彰優秀技術賞は、国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)の上杉文彦氏に贈られた[4]. 題目は「TEMデータを味わい尽くす」である(TEM:透過電子顕微鏡).受賞理由は表彰式で,「収差補正高分解能電子顕微鏡, EDS(エネルギー分散型X線分光),EELS(電子エネルギー損失分光)などの先端TEM技術を駆使し、ユーザーにハイレベルの研究成果創出をもたらした.特に卓越したスキルとして,スクリプト言語のプログラミングに長け,取得データの画像処理や多変量解析により,精緻なデータ解析を可能にし,機械学習を加えてこれまでは得られなかった情報の取得に成功した.」と紹介された.表彰の後日,受賞技術の内容・支援状況を,受賞者のNIMS技術開発・共用部門評価プラットフォーム電子顕微鏡ユニット主幹エンジニア上杉文彦(うえすぎふみひこ)氏にオンラインで伺った.



実験室の上杉氏



nano tech 2023 ARIM Japan ブースで 賞状と記念バッジとともに

1. ARIM における受賞者の技術支援

1.1 物質・材料研究機構 (NIMS) マテリアル先端 リサーチインフラ (ARIM) の概要

ARIM Japan は、7つの重要技術領域(略称で、1. 高 度なデバイス機能マテリアル、2. エネルギー変換マテリ アル、3. 量子・電子マテリアル、4. マテリアルの高度 循環技術、5. バイオマテリアル、6. ナノスケールマテ リアル、7. マルチマテリアル化技術・高分子マテリアル) のそれぞれに強みを持つ先端装置群を提供するハブ機関 と、特徴的な装置・技術を持つスポーク機関からなるハ ブ&スポーク体制で、利用者の研究開発を支援する. 共 用する装置は3つの技術領域(1. 計測・分析、2. 加工・ デバイスプロセス、3. 物質・材料合成プロセス)で提供 される[1]. ARIMには、装置共用により得られるデータ を利用者の許可を得た上で収集・蓄積し、データ活用型 研究開発に資するデータベースを構築し共用を図るデー タ中核拠点となるセンターハブが設けられた.

NIMS はセンターハブの機能を果たすと共に,ハブが取 り上げる上記7 重要技術領域のうちの「3.量子・電子制 御により革新的な機能を発現するマテリアル」,「4.マテ リアルの高度循環のための技術」の2 領域を担当し,上 記3つの技術領域,すべての領域の装置を提供している. NIMS マテリアル先端リサーチインフラは,NIMS ARIM の略称で運営され [5],NIMS 組織における技術開発・共 用部門が運営する NIMS Open Facility (NOF)と連携する. NOF は,物質・材料やナノテクノロジーに関する先端装 置および大型装置を保有し,NIMS の研究者のみならず国 内外の大学,企業,公的機関の研究者が行なう研究開発 をサポートする [6].NOF には,7つのユニットがあり, 上杉氏は,その一つ,電子顕微鏡ユニットに所属する.

1.2 NIMS ARIM 共用設備 [5]

NIMS ARIM は3つの技術分野:計測・分析分野/加工・

デバイスプロセス分野/物質・材料合成プロセス分野の 装置を共用に供する [7]. NIMS には茨城県つくば市に複 数の事業所があり,共用装置は,つくばエリアの千現地 区 (本部),並木地区,桜地区の3拠点に設置されている(表 1).表1で,計測・分析分野の共用装置は,NMR,材料 分析,3D,TEM の技術分野に分けて示されている.

本稿の関係する TEM 分野(千現地区)の共用装置を, さらに詳しく表2に示した.透過電子顕微鏡, TEM 試料 ホルダー, FIB(集束イオンビーム)試料加工装置, 断層 像解析ソフトなど 16 点が ARIM ホームページに掲載され ている.

1.3 NIMS ARIM 計測・分析分野の共用装置利用支援

NIMS ARIM 共用装置の利用方法 [8] には, 表3 に示す 3 つの形態がある.

利用件数は, NPJ の NIMS 微細構造解析プラットフォーム (ARIM の計測・分析分野に相当) におけるコロナ禍前の 2017 年度では 202 件であった.

1.4 受賞者の NIMS ARIM における支援活動

受賞者の上杉氏は、民間の計測・分析会社から、2014 年に NIMS に加わり、NIMS 微細構造解析プラットフォー ムの電子顕微鏡担当技術スタッフとなった.他の技術ス タッフ同様、装置の保守・運用、装置使用に当たっての 試料作製、機器操作、観察結果の解析まで、電子顕微鏡 微細構造解析に関する業務の全てを行なっている.機器 利用の支援では、表3の機器利用、技術補助、技術代行 のいずれも行うが、3つの支援形態の中では技術代行が 多いという.表彰式の受賞者挨拶で上杉氏は、「大学で格 子欠陥の研究に従事して電子顕微鏡を扱ってから、30年 になる.ニッチなところを歩んできた.長年積み上げて きたものが役に立った.これからも技術向上に励み、変 化には柔軟に対応したい.」と語った.ニッチは他人のや らないことでもある.新しいことに挑戦するから、開発・ 習得した技術は、利用者が容易に利用できるものではな

技術分野		設置場所	装置例	
物質・材料合成プロセ ス分野		千現地区	液中原子間力顕微鏡	
計測 · 分析	NMR 分野	桜地区	500 MHz 固体汎用 NMR システム	
	材料分析分野	千現・並木地区	走査型デュアルX線光電子分光分析装置(HAX-	
			PES/XPS)	
分野	3D 分野	千現地区	微細組織3次元マルチスケール解析装置	
	TEM 分野	並木地区	単原子分析電子顕微鏡	
	TEM 分野	千現地区	実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡	
加工・デバイスプロ セス分野		千現地区	電子ビーム描画装置(ELS-F125)	

表 1 NIMS ARIM の共用設備

名称	実動環境対応物理分	200kV 電界放出形透	200kV 透過電子顕微	2 軸傾斜液体窒素冷却
	析電子顕微鏡(JEM-	過電子顕微鏡1	鏡 (JEM-2100)	TEM 試料ホルダー
	ARM200F-G)	(JEM-2100F1)		(Gatan 636)
装置				
名称	デュアルビーム加工 観察装置(NB5000)	FIB 加工装置 2 (JEM-9320FIB)	電子線トモグラフィ 一解析システム	TEM 試料作製装置群
装置				

表 2 NIMS ARIM TEM 分野(千現地区)の共用装置(抜粋)

表 3 NIMS ARIM の支援形態

支援形態	支援内容		
機器利用	ーー 利用者自身で操作:機器は利用者自身が操作して実験し,データの解析や考察も利用者		
	が行う		
技術補助	技術スタッフが補助:利用者は操作方法などについて,技術スタッフの補助を受けなが		
	ら機器を使用する		
技術代行	利用者に代わり技術スタッフが操作:依頼に基づき,技術スタッフが実験・測定・評		
	価・解析を行う		

い. これが,電子顕微鏡利用の難しさに加えて,技術代 行が多くなる理由かと推測する.

以前,上杉氏は,NPJのWebジャーナル: NanotechJapan Bulletinのインタビューを,装置利用者に 並んで受けた.その内容は,最先端の研究設備の共同利 用により得られた研究成果を発信する企画特集「ナノテ クノロジーPickUp」に「イオン液体中の微細構造解析」 として掲載された[9].イオン液体は,イオン結晶のよう に陽イオンと陰イオンで構成される液体で,電池の電解 質やバイオマスの溶媒などへの応用が期待される新材料 である.利用者の東北大学宮田智衆氏は,イオン液体 中の単原子イオンの挙動を観察したかった.これに対し, 液体の電子顕微鏡観察に難色を示すことが多い中,上杉 氏が NIMS の高分解能電子顕微鏡による観察支援を引き 受けた.新たな液体試料作製法などの新技術開発が加わっ た支援により,宮田氏は溶媒中の単原子イオンの運動の 追跡に初めて成功した.

他人のやらないこと,新しい手法に挑戦する上杉氏は, 共用装置利用者の支援業務を遂行する傍ら,電子顕微鏡 のより深い活用法の開拓,即ち,電子顕微鏡の大量デー タを活用し,画像処理や統計的手法,機械学習などを組 み合わせた複合的な解析により,隠れた高度な情報を引 き出すことに挑戦した.以下に STEM から大量のデータ が生み出される仕組みと,大量のデータから必要な情報 を引き出す3件の試みと成果を紹介する.

2. TEM (透過電子顕微鏡) データの複合 的な解析のきっかけ

2.1 TEM 微細構造解析・画像表示

電子顕微鏡は, 試料を透過した電子を蛍光板に拡大・ 結像させる透過型から始まった.次いで, 電子線を走査 して試料からの二次電子をブラウン管に表示する走査型 が生まれた.二次電子の検出は, 検出器に代わり, コン ピュータを用いて2次元の像を形成するようになり, 電 子顕微鏡のデジタル化が進んだ.更に, 透過電子顕微鏡 (TEM)に走査電子顕微鏡(SEM)の技術を取り入れ,集 束レンズによって細く絞った電子線プローブを試料上で 走査し,試料の照射位置で散乱され,透過した電子線を 検出し,照射位置と対応させてイメージ(画像)化す る走査透過電子顕微鏡(STEM, Scanning Transmission Electron Microscope)へと発展する.STEMは,微少領 域の電子回折や元素分析が可能なため,原子分解能など 高分解能の透過電子顕微鏡(TEM)の多くは,STEMになっ た.走査点ごとに集められた検出電子データをコンピュー タ処理して,電子顕微鏡画像や電子回折パターンを構成 する.デジタルデータの取得,コンピュータ処理は電子 顕微鏡の機能の一部となり,市販電子顕微鏡の付属品と なった.

図1にSTEMの構成と機能を示す. TEMの分解能を高



図1 STEM の概略図

めるために電子レンズの収差を補正する球面収差補正装 置(Aberration corrector)から出力した走査電子線は, 試料を透過,直進して環状明視野(ABF, Annular Bright Field)で検出するか,あるいは試料通過時に大きく散乱 され円環状の暗視野領域(広角環状暗視野:HAADF, High Angle Annular Dark Field)で検出して,画像化される. さらに,試料の照射位置からの特性 X 線を検出器 SDD (Silicon-Drift Detector)で検出・分析する EDS (Energy Dispersion Spectroscopy,エネルギー分散 X 線分光)に より照射位置の原子がどの元素であるかを同定できる [10].

2.2 TEM 画像の複合的な解析のきっかけ

上杉氏は NIMS に入る前の民間の計測・分析会社で TEM を担当し、半導体中の歪み測定を依頼された. Si な どの半導体に応力をかけて歪みが生じるとバンドギャッ プが変わり、キャリア移動度が変化するのでデバイス特 性に影響する.依頼は、微細構造 Si MOSFET 内の微細領 域の伸び縮みを、TEM の電子回折によって格子定数を測 ることで求められないか、というものだった.図2中央 上部に試料 MOSFET の断面構造を示す.表面に形成され たコンタクト電極の先に SiGe のソース或いはドレイン領 域があり、その間の表面にゲート電極が形成されている. 赤枠で囲んだ部分が歪みを評価する領域である. そこで まず,観察者が試料を動かし,場所を選んで一点,一点, 電子回折図形(Diffraction pattern:DP)を取得した.こ れでは時間がかかり十分なデータが取れないばかりか, データを取得したサンプル上の位置を後々保証できない. そこで、ナノスケールの電子ビームを用いる STEM-NBD (Nano Beam electron Diffraction) により (図2左), ビー ムをスキャンしながら DP を取得した. 散乱された電子



図 2 STEM-NBD による Si MOSFET 内部の歪み測定

線は環状検出器によって検出され,ADF 像が取得できる. ADF 像から DP の取得位置は保証される.本手法を用い ることにより自動で多くのデータを取れるようになった が(図2中下),今度は人間が解析するにはデータが多過 ぎる.そこで,Gatan 社の DigitalMicrograph というアプ リケーションのスクリプト機能を用いて回折スポットの 距離を自動で測るプログラムを作成し,0.1%の精度で歪 み変化を捉えることに成功した.図2右中・下に,評価 結果の歪み分布を色分けして(圧縮は青,伸張は赤)示 した[11](図2の測定結果は,同じ手法を用いて NIMS において測定したもの).

2.3 TEM 画像の複合的な解析に向けて

当時は図2に示すように ABF 像の検出に CCD カメラを 用いているが,その後さらに高感度・高速のカメラが開 発された.264×264 pixels なら,毎秒1,000 フレーム の速度(1,000 fps)で画像が撮れる.4 k×4 kの高解 像度でも25 fpsのフレーム速度が得られる.取得できる データの数も以前は多くても100 枚だったのが,近年の PC の処理能力とストレージの大容量化により今では何万 枚もの回折図形を撮れるようになった.試料上で電子プ ローブを走査する各点ごとに,DP を記録する手法は,試 料走査面での2次元に加え,検出面での2次元情報が得 られるので,4D-STEM 法とも呼ばれる.

TEM で取得される DP には、空間群、結晶構造、歪み、 原子配列などの結晶に関する情報が豊富に含まれている. しかし、これまでの TEM は選ばれた領域の電子回折といっ た一部のデータしか利用していない.

一方,大量のデータ,所謂ビッグデータを扱う機械学 習や統計処理が近年注目を集めている.例えば,国民生 活では国勢調査から得られるビッグデータの統計処理で 人口動態の将来予測や、コンビニのレジから得られたビッ グデータから顧客性向などの有効な知見を導き出してい る.ビッグデータに機械学習や統計処理を適用すること で、個々のデータを解析するのとは質の異なった情報が 得られる.

上杉氏は、TEM で得られる大量データの有効利用に、 統計的手法や機械学習が使えないかと考えた. 前節に複 合解析のきっかけとした歪み検出では、興味ある場所で DP のスポット間の距離を測って格子定数を求め、無歪の 領域の格子定数と比べて歪みがどれだけあるかを見てい た. 先の解析は単結晶を対象としたものであるが、多結 晶や多層ナノシートから得られる複数の DP が重なった状 態を解析しなければいけない場合もある. 少数の DP の解 析では、結晶の情報、面と面の角度関係、消滅則などの 知識を使って個々の DP に分離し、その後所望の解析を行 うことができる.しかし、4D-STEM データのように多量 に DP がある場合には人間技では到底無理である. さまざ まな DP が重なっている DP から個々の DP を分離できな いかと考えた. その際, EELS や EDS のスペクトル解析で, 重なったスペクトルを統計処理の多変量解析で分解して いる論文を見つけた [12].

図3で,観測された電子回折像に一本の線を引いてみ るとその線に沿って電子線強度のラインプロファイルが とれる.これをスペクトルと見なすと,縦の線ごとにス ペクトルが得られる.電子回折像はスペクトルの重ね合 わせとなるから,2次元のデータを並べ替えて1列のデー タにすることで同じ手法が使えないかと考え,TEMデー タの多変量解析を試みることになった.

これに続き, TEM データから人力だけでは難しい有効 情報の抽出に向け, 多変量解析に加えて, 機械学習を伴 うトポロジーと AI (人工知能)を組み合わせた解析, 同 心円状ウェーブレットによる画像処理を行なった.



図3 電子回折パターンのスペクトル展開のアナロジー



3.1 多変量解析を用いた 4D-STEM データ解析 [13]

多変量解析 (Multivariate Analysis) は、多変量のデー タの特徴を要約する統計手法である.多変量解析には様々 な手法があり、PCA (Principal Component Analysis, 主 成分分析) だと負の成分が出て、直感的に理解しにく い. MCR (Multivariate Curve Resolution:多変量スペク トル分解) は、非負値行列因子分解 (NMF: Nonnegative Matrix Factorization) ともいい、成分は正になるので解 析結果を理解し易い. このため MCR を用いて、TEM デー タの多変量解析を行なった.

まず, TEM の 4D データを行列に変換する. 図 4 にお いて 4D データから右上の回折パターン, n × n のピクセ ルイメージを行列に変換し, 左下の 1D 回折データから成 る 3D データを 2 次元行列に変換して, 4D-STEM データ の 2D 行列 *X* とする.

4D-STEM データは試料中の異なる点からの電子回折の 重なりである.特定の点からの電子回折を多変量解析で分 離するのは,実験で得られた信号の行列 X を,着目する点 を表す行列 C と回折図形の行列 S に分解することになり,

 $X = SC \qquad (1)$

である.この関係式からSを求めて行くが、初めは何も

わからないのでCの要素には乱数を入れておく.両辺に Cの転置行列C^Tを掛け,CC^Tの逆行列を掛けるとSが求 まる.

$$\boldsymbol{X}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}, \ \boldsymbol{S} = (\boldsymbol{X}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}) (\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}})^{-1}$$
(2)

得られたSの要素で負のものはOにし、このSを用いて Cを改める.

$$\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}\boldsymbol{C}, \quad \boldsymbol{C} = (\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S})^{-1}(\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}) \quad (3)$$

この *C* でも負の要素は 0 に修正し,式(2)に戻って式 (3)に進む.これを収束するまで繰り返す.収束の結果 として得られた行列 *S* が分離された回折図形である.こ の MCR 計算は標準的なパソコンで行い,以下に示す例で は,収束までの反復回数は 100 回程度,計算時間は 20 分程度であった.

この手法の検証には酸化チタン(Ti_xO_y)ナノシートの 構造解析を用いた.酸化チタンにはTiO₂,Ti₂O₃といった 複数の化合物があり,試料の酸化チタンナノシートは酸 素濃度 y の異なる領域が混在しており,さらにナノシー トの層数も異なっている.この試料から得た ADF-STEM 像と 4D-STEM データの解析結果を図5に示す.実験で 得られる 4D データは酸素濃度の異なる複数の領域からの DP の重ね合わせである.図5(a)は ADF-STEM 像(中央) と解析前の 4D-STEM によって得られた DP の一部が周り に示してある.赤の数字は ADF-STEM 像の強度から推定 できるシートの層数である.層数が多いほど複雑な DP で





図 5 酸化チタンナノシートからの 4D-STEM データの多変量解析結果. (a)酸化チタンナノシートの ADF-STEM 像と 多変量解析結果前の DP. (b)多変量解析によって分解後の DP (下段)とそれぞれの DP に対応した領域(上段.DP の 枠の色と領域の色は対応している)

あることがわかる.図5(b)は、多変量解析によって分 解された DP(下段)とそれらの DPが生じる領域を示し てある.DPの外枠の色と領域の色は一致している.図5 (b)右の水色の枠と赤の枠で囲まれた DPは一見双晶から の DPに見え、分解が不十分であるように思われるかもし れない.それらに含まれる個々の DPを生じるような領域 がサンプル上に存在すれば、それぞれの DPの情報を用い てそれらは分解できるが、今の場合、重なったナノシー トしかこの領域に無いのでこれ以上分解できない.多変 量解析が実験によって得られた大量の情報を用いて、少 数の要素を見つけ出していることがわかる.

3.2 トポロジーと AI を組み合わせた解析方法 [14]

TEM 解析の対象は結晶質とは限らない. 半導体 LSI の 素子分離領域は、SiO₂, SiN_xの反復 CVD(化学気相蒸着) とパターンエッチングによる浅溝分離(STI: Shallow Trench Isolation)などで作るから、結晶質の Si 基板と非 晶質の SiO₂, SiN_x絶縁膜が混在する. 異種物質との接合 により Si に歪みが生じ,製造条件により非晶質領域の構 造が変わる. 結晶質領域と非晶質領域を分離して解析し たい,といった要求が起こる. しかしアモルファス(非 晶質)材料の TEM 像の解析は、結晶のもつ周期性がない ため難しい.とはいえ,長距離の規則性,周期性はなく とも,アモルファスの中で短距離の規則性は存在し,原 子は繋がっている,上杉氏は,データの繋がり方(トポ ロジー)を解析するトポロジカルデータ解析に着目した.

トポロジカルデータ解析では、データの繋がり方(ト ポロジー)がデータの集合の特徴を表していると考え. 繋がり方によって生ずる環や空隙といった「穴」に対応 する構造の定量化を行う. その手法として, トポロジカ ルデータ解析の一つであるパーシステントホモロジー (Persistent Homology, PH) を取り上げた.図6にその概 要を示している.図の上段に示すように、データ点を中 心にした円を描き、その半径をr₁, r₂, r₃…と増やしていっ たときに、r₂でデータ点のリングの円が繋がってリング が生成され、穴ができる(birth). r₃で穴が被覆されて消 滅する (death). r₄ で二つのリングが形成され, その一 つは r₅ で穴が消滅し, もう一つは r₆ で穴が消滅する. 図 6上段2列目は、一列目の状況変化をデータ点の接続関 係で表現したもので、穴の消滅は、リンクを黒く塗り潰 している.図6の下段は、これらの変遷を、横軸に生成 (birth)時の半径,縦軸に消滅(death)時の半径を取って, リングごとにプロットしたパーシステント図(PD)である. データ点が散在する複雑な図形が、PD により数値データ に変換され、この数値データを機械学習や統計解析に利 用する.

PHによりアモルファス状態を解析する手法の妥当性を 確かめようと,TEM 画像で液体状態とアモルファス状態 がPHによって識別できるか,シミュレーションを行なっ た.先ず,50Å×50Å×50Åの大きさの結晶モデルを 作成し,計算化学ソフトウェア LAMMPS[15]を用いて分 子動力学(MD)シミュレーションを行なった.1000 K, 4000 K,6000 K で昇温と300 K への急冷を行った.昇 温状態の原子座標と急冷したもので PH 解析を行った結 果を図7に示す. その結果 4000 K のものでは, 実際に は融点が2500 K であるにもかかわらず, 原子座標はラ ンダムにはならず溶融していることは確認できなかった. さらにそれを急冷したものの PD は 1000 K のものと一致 した. 分子動力学ではこのようなことはよくある. 6000 K では原子座標は全く 1000 K, 4000 K と異なり急冷し たものも同様に 1000 K および 4000 K の急冷のものと異 なっていた. そこで以後 6000 K のもので液体 (without RT) とアモルファス (with RT) の原子座標を用いて TEM シミュレーションを行い, これらについて PH 解析 を行った. TEM 像は電子線画像シミュレータ (ELBIS) を 用いて作成した. 一部を図7 の中央の列に示してある.

TEM 画像は完全に焦点が合った状態で取得できると限 らないので,±100 Åの範囲で焦点を振った画像を用意 した.これらの画像の PD を作成し,機械学習(Logistic classification)を行い,液体からの像とアモルファスから の像を分離できるように学習した.PD は 0 次と 1 次の ものを連結したものを使った.学習した結果,±100 Å では 75% 程度,just focus に近いところでは 85% 以上の 正答率を得られた.液体では,Birth-Deathペアが PD の 対角線に近い側に,アモルファスではそれより遠くに生 じやすいという結果が得られた(図 8.暖色の領域が液体, 寒色がアモルファス).液体では構造が完全にランダムに なっているのに対し,アモルファスではある程度秩序が あることが 2 次元の TEM 像でも表れていることがうかが える.

3.3 同心円状ウェーブレットによる画像処理[16]

TEM の性能向上と TEM を制御するコンピュータの高 速化がもたらした大量データの活用には画像処理が重要 になる.ノイズ除去,特徴抽出,図形や輪郭の強調など



図6 パーシステントホモロジー (PH) の概念図



図7 MDによって作成した結晶モデルの俯瞰像(左), TEM シミュレーション像(中央)と3次元データからの1次PD(右)



図 8 PH を用いたアモルファス解析. (a)機械学習によって領域分けした1次の PD.(b),(c)逆解析結果.アモルファスと液体の領域ある点が像のどこから生じたかを示す.

を行えば, TEM データから追加の情報を引き出すことが できる.

TEM データにおいて,図形や輪郭の強調にはフーリエ 変換(Fourier Transform, FT)が用いられてきた.一次元 なら FT は次式で表され,

$$f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

入力関数 f(x) の周波数 ω における FT には, x に関する 情報がなくなっている. 窓関数を用いる窓フーリエ変換 WFT により x の情報を残すことができるが, 窓幅を周波 数に合わせて固定するため、広い周波数領域の解析には 向かない.これに対し、小さい波(Wavelet)を拡大縮小、 平行移動して足し合わせることで、入力波形を表現する ため広い周波数領域の解析が容易になるウェーブレット 変換(WT)が考え出された.WFTの窓関数に相当する マザーウェーブレット $\psi(x)$ を用いて入力データf(x)の ウェーブレット変換(W_wf)は次式で表される.

$$(W_{\psi}f)(b,a) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{x-b}{a}\right) f(x) dx$$

ここで、aは局在度、bは位置を表し、a,bを調整してマ

ザーウェーブレットを作る.画像のような二次元データ には二次元ウェーブレット変換 2D-WT が定義されるが, 従来の画像変換に用いられたメキシカンハット型の中心 対称 (centrosymmetric)のウェーブレットを使うと,格 子状に配列した円を変換した時に,元々あった円の間に 新たに円が現れるといった不都合が起きる.そこで,図9 に示す同心円状 (concentric)ウェーブレットを用いるこ ととした.

同心円状ウェーブレットによる画像処理では,図9(a) の一連のマザーウェーブレットで画像データを変換する. ウェーブレットは鳥瞰図で見ると図9(b)の形状で,中 心付近の強度分布は図9(c)のように双峰性を示し,同 心円状に強度が高くなっている.

処理の手順は、図10に示すように、原画像と一連の ウェーブレットの相互相関関数で得られた変換画像群か ら,必要な画像を選んで再構成する,というものである(図 10の★は相互相関関数を表す).

この同心円状ウェーブレット変換をストロンチウム化

合物 SrAlSi₄N₇の ADF-STEM 画像に適用して画像処理を した結果を図 11 に示した.この化合物は、図 11 (c) に 重ねられているように、Sr 原子と Al 及び N の鎖構造か らなる.原画像:図 11 (a)の中心部を FT 処理して拡大 すると図 11 (b)となる.Sr の像だけが残り、他の原子 は消えてしまう.512×512の画像を 256 枚の同心円状 ウェーブレットで処理し、全てを足し合わせると (Slices 0-255)、原画像と同等の画像:図 11(d)だが、一部のウェー ブレット (Slices 27-62)を足し合わせた図 11 (c)では Sr 原子が図 11 (d)より鮮明に表示されている.

また,64×64ピクセルというデータ量の比較的少な いα-SiNのEDSマッピングに同心円状ウェーブレット 画像処理を適用して画質向上を図った.画素数が小さな 画像ではフィルタが使いにくくFTによる特徴抽出は難し い.未処理のNのマップ(図12の上段の右列)を見る とほとんどノイズにしか見えないが,本手法を用いたマッ プ(同図下段右列)では強度の高いところがNサイトに 一致していることがわかる.本手法を適用したNマップ





図11 一部ウェーブレット選択による画像強調



図 12 EDS 元素マップの画像強調



図13 2次元多層薄膜材料の構造解析

を一度見た後,未処理の画像を見てみると,処理後のマッ プで強度が高く表示されている箇所は未処理のマップで もノイズに埋もれながらも高い強度を示していることに 気づくことができる.画像処理は人間の認知の助けにな ることがわかる.

一方, グラフェンのような 2 次元物質は, 3 次元物質 に比べて優れた, 特異な物性を示す. 層状結晶となる Bi-Te の多層薄膜成長を行い, 組成などの相の異なる層が 得られているか確認するのに ADF-STEM 観察を行い, 同 心円状ウェーブレット画像処理を行った(図 13). Si 基 板にマグネトロンスパッタで形成された Bi-Te 層の ADF-STEM 像が Bi または Te の原子配列に分解され(図 13 下 段), Bi-Te 層状配置像に変換された. 組成の異なる Bi-Te 二次元膜の重なりを, TEM で直接, 観察することに成功 した(図 13 上段). この解析は, NPJ の装置共用におけ る微細構造解析の技術代行の中で行われた [17].

同心円状ウェーブレット画像処理は、フーリエ変換に よる画像処理よりも柔軟性があり、画像強調やノイズ処 理の有効な手段である.「画像処理は、偽物の画像を作り 出してしまうような好ましくない手法と思われる方もい ると思うが、時と場合によって適宜使い分けることがデー タ解析では必要なのではないか」と上杉氏は云う.



電子顕微鏡はナノテクノロジーの世界を観察する主要 手段である.分解能は、走査透過電子顕微鏡 (STEM) で 原子レベルに達した. STEM では試料面の2次元走査と 検出面の2次元位置を合わせた4Dデータが得られる.装 置の高精度化・高速化、装置を制御する計算機の高速化 とメモリーの大容量化により取得できるデータは飛躍的 に増大した. 大量のデータから有効な情報を抽出すべく, 上杉氏は, 画像処理, 統計的手法, 機械学習などの活用 を提案した.提案した手法には技術代行で利用したもの もあるが、このほか、10~20行の小さなスクリプトを 日常的に作成・使用して、技術代行における画像の加工 やデータの整理に役立てているという.しかし、このよ うな活動,解析の過程は,解析結果に比べて表に出にくい. これからは、電子顕微鏡構造解析におけるデータ処理の 重要性を再認識し、大容量データからより多くの情報を 引き出すことにより、材料データの集積が進み、材料革 新が促進されることを期待する.



- [1] ARIM Japan 文部科学省 マテリアルリサーチインフラ https://nanonet.mext.go.jp
- [2]「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェク

ト事業」について

https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/nano/data_ driven_fs_00001.html

- [3] 令和4年度技術スタッフ表彰 https://nanonet.mext.go.jp/page/awards_for_ technical_staff_R04.html
- [4]【優秀技術賞】「TEM データを味わい尽くす」 https://nanonet.mext.go.jp/data/doc/1675129320_ doc_10_0.pdf
- [5] NIMS ARIM https://www.nims.go.jp/arim/
- [6] NIMS Open Facility https://www.nims-open-facility.jp
- [7] NIMS ARIM 利用装置 https://www.nims.go.jp/arim/facilities/facilities2. html
- [8] NIMS ARIM 利用について https://www.nims.go.jp/arim/use/flow.html
- [9] イオン液体中の微細構造解析, NanotechJapan Bulletin Vol. 13, No. 1, 2020 https://nanonet.mext.go.jp/data/doc/1654488562_ doc_10_0.pdf
- [10] 原子分解能 STEM-EDS マッピングによる原子カラムの可視化 NanotechJapan Bulletin Vol. 11, No. 2, 2018 https://nanonet.mext.go.jp/data/doc/1653013123_ doc_11_0.pdf
- [11] Fumihiko Uesugi, Akira Hokazono, and Shiro Takeno, "Evaluation of two-dimensional strain distribution by STEM/NBD", *Ultramicroscopy*, Vol. 111, Issue 8, pp. 995-998 (2011)
- [12] Shunsuke Muto, Tomoko Yoshida, and Kazuyoshi Tatsumi, "Diagnostic Nano-Analysis of Materials Properties by Multivariate Curve Resolution Applied to Spectrum Images by S/TEM-EELS", *Materials Transactions*, Vol. 50, No.5, pp. 964-969 (2009)
- [13] Fumihiko Uesugi, Shogo Koshiya, Jun Kikkawa, Takuro Nagai, Kazutaka Mitsuishi, and Koji Kimoto, "Non-negative matrix factorization for mining big data obtained using four-dimensional scanning transmission electron microscopy", *Ultramicroscopy*, Vol. 221, pp. 113168-113173 (2021)
- [14] Fumihiko Uesugi, and Masashi Ishii, "Classification for transmission electron microscope images from different amorphous states using persistent homology", *Microscopy*, Vol. 71, No. 3, pp. 161-168 (2022)
- [15] Aidan P. Thompson, H. Metin Aktulga, Richard Berger, Dan S. Bolintineanu, W. Michael Brown, Paul S. Crozier, Pieter J. in 't Veld, Axel Kohlmeyer, Stan

G. Moore, Trung Dac Nguyen, Ray Shan, Mark J. Stevens, Julien Tranchida, Christian Trott, and Steven J. Plimpton, "LAMMPS - a flexible simulation tool for particle-based materials modeling at the atomic, meso, and continuum scales", *Computer Physics Communications*, Vol. 271, February 2022, 108171

- [16] Fumihiko Uesugi, "Proposal of a new image processing method inspired by wavelet transform", Submitted to *Nanoscale*
- [17] Yuta Saito, Paul Fons, Kotaro Makino, Kirill V.

Mitrofanov, Fumihiko Uesugi, Masaki Takeguchi, Alexander V. Kolobov, and Junji Tominaga, "Compositional tuning in sputter-grown highlyoriented Bi-Te films and their optical and electronic structures", *Nanoscale*, Vol. 9, pp. 15115-15121 (2017)

(図1以外の図は全てNIMS上杉氏から提供された)

(古寺 博)